

2010年9月27日

日本エフイー・アイ株式会社に対する特許侵害損害賠償請求の訴訟について

株式会社日立ハイテクノロジーズは、2010年9月22日に、日本エフイー・アイ株式会社を当社の集束イオンビーム技術に関連する特許を侵害したとして、損害賠償の請求等を東京地方裁判所に提訴しました。当社は2010年7月29日にも日本エフイー・アイ株式会社に対して損害賠償請求を提訴しており*、今回は当社の別の特許権で提訴したものです。

また、日本エフイー・アイ株式会社には、2009年11月6日に特許侵害差止請求を東京地方裁判所に行なっており**、現在係争中です。

*) 2010年7月30日付ニュースリリース

日本エフイー・アイ株式会社に対する特許侵害損害賠償請求の訴訟について

http://www.hitachi-hitec.com/news_events/ir/2010/nr20100730.pdf

**) 2009年11月6日付ニュースリリース

日本エフイー・アイ株式会社に対する特許侵害訴訟について

http://www.hitachi-hitec.com/news_events/product/2009/nr20091106_2.pdf

(ご参考) 2010年6月30日付ニュースリリース

FEI Company 製 FIB/SEM 装置の輸入差止について

http://www.hitachi-hitec.com/news_events/ir/2010/nr20100630.pdf

【報道関係問い合わせ先】

社長室 広報・IR グループ 担当：松本

TEL：03-3504-3258